

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005 年 8 月 4 日 (04.08.2005)

PCT

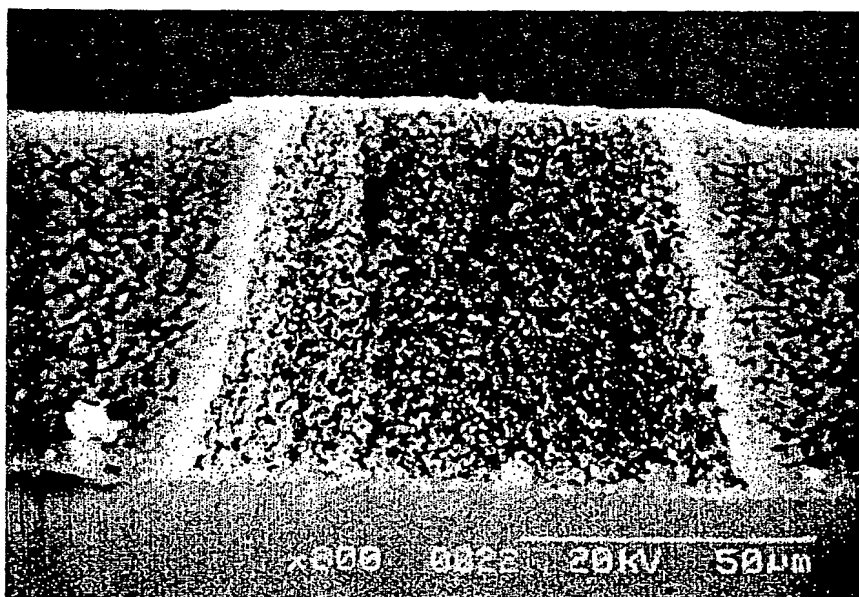
(10) 国際公開番号  
WO 2005/070611 A1

- (51) 国際特許分類: B23K 26/38 (72) 発明者: および  
(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/001051 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 増田 泰人 (MA-SUDA, Yasuhito) [JP/JP]; 〒5540024 大阪府大阪市此花区島屋一丁目 1 番 3 号 住友電気工業株式会社大阪製作所内 Osaka (JP). 奥田 泰弘 (OKUDA, Yasuhiro) [JP/JP]; 〒5540024 大阪府大阪市此花区島屋一丁目 1 番 3 号 住友電気工業株式会社大阪製作所内 Osaka (JP). 三島 英彦 (MISHIMA, Hidehiko) [JP/JP]; 〒5540024 大阪府大阪市此花区島屋一丁目 1 番 3 号 住友電気工業株式会社大阪製作所内 Osaka (JP).  
(22) 国際出願日: 2005 年 1 月 20 日 (20.01.2005)  
(25) 国際出願の言語: 日本語  
(26) 国際公開の言語: 日本語  
(30) 優先権データ: 特願2004-016286 2004 年 1 月 23 日 (23.01.2004) JP (74) 代理人: 西川 繁明 (NISHIKAWA, Shigeaki); 〒1160014 東京都荒川区東日暮里三丁目 4 番 9 号 ビジュアル・シティー 401 号 Tokyo (JP).  
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友電気工業株式会社 (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.) [JP/JP]; 〒5410041 大阪府大阪市中央区北浜四丁目 5 番 3 3 号 Osaka (JP). (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,

/ 続葉有 /

(54) Title: STRETCHED POLYTETRAFLUOROETHYLENE POROUS ARTICLE HAVING FINE PORES FORMED THEREIN AND METHOD FOR PRODUCTION THEREOF, AND METHOD OF ABLATION MACHINING

(54) 発明の名称: 微細孔が形成された延伸ポリテトラフルオロエチレン多孔質体及びその製造方法並びにアブレーション加工方法



(57) Abstract: A stretched polytetrafluoroethylene porous article having fine pores formed therein, wherein fine pores having a pore diameter greater than the average pore diameter of said stretched polytetrafluoroethylene porous article are formed by the irradiation with a pulse laser beam having a pulse width of 10 picoseconds or less, and a fine porous structure of the wall surface of said fine pore is not broken and is substantially retained; a method for producing the stretched polytetrafluoroethylene porous article; and a method of ablation machining.

/ 続葉有 /

WO 2005/070611 A1



BD, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,  
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,  
NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,  
SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,  
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),  
OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,  
MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SI, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約: 延伸ポリテトラフルオロエチレン多孔質体に、10ピコ秒以下のパルス幅を有するパルス・レーザービームの照射により、該延伸ポリテトラフルオロエチレン多孔質体の平均孔径より大きな孔径を有する微細孔が形成されており、かつ該微細孔の壁面の微細多孔質構造が破壊されることなく実質的に保持されている微細孔が形成された延伸ポリテトラフルオロエチレン多孔質体及びその製造方法並びにアブレーション加工方法。